科学研究費助成專業 研究成果報告書



平成 29 年 5 月 3 1 日現在

機関番号: 34315

研究種目: 基盤研究(B)(一般)

研究期間: 2013~2016

課題番号: 25287108

研究課題名(和文)高分子多層膜法による動的不均一性の計測と制御

研究課題名(英文)Dynamical heterogeneity measured for multi-layered thin polymer films

研究代表者

深尾 浩次 (Fukao, Koji)

立命館大学・理工学部・教授

研究者番号:50189908

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 14,700,000円

研究成果の概要(和文):1.PMMA積層薄膜のガラス転移温度と 過程のアニール過程における変化を誘電緩和測定と示差熱量測定により調べた.as-stackedな状態で,ガラス転移温度は薄膜で観測されるようにバルクより低下していたが,ガラス転移温度以上でのアニールにより,バルクでの値へと近づいた.この変化に対応して 過程のダイナミクスも変化した. 2. ポリアミドランダム共重合体薄膜のダイナミクスを誘電緩和測定により調べた.EP過程の緩和時間と緩和強度の膜厚依存性を測定データから評価し,モデル計算により,電荷担体の拡散係数と密度を膜厚の関数として評

価した、その結果、薄膜において電荷担体の拡散係数の本質的な増大が観測された。

研究成果の概要(英文): 1. The glass transition temperature (Tg) was investigated during annealing above Tg for stacked thin films of poly(methyl methacrylate) (PMMA). The Tg of as-stacked PMMA thin films exhibits thin-film-like behavior, insofar as Tg is depressed and the dynamics of the process are faster than those of the bulk system. Annealing at high temperature causes Tg to increase from the reduced value approaching those of the bulk.

2. We investigate the relaxation of thin films of a polyamide random copolymer. Two dielectric

signals are observed at high temperatures, the process and the electrode polarization (EP) process. The relaxation time and the dielectric relaxation strength of the EP process are described by a linear function of the film thickness d for large values of d. Furthermore, there is distinct deviation from this linear law for thickness smaller than a critical value, which suggests that there is an increase in the diffusion constant of the charge carriers for the EP process.

研究分野: ソフトマター物理学、高分子物理学

キーワード: ガラス転移 積層薄膜 誘電緩和 電極分極過程 ポリメチルメタクリレート ポリアミドランダム共 重合体

1.研究開始当初の背景

非晶性の物質では結晶性の物質で見られる ような明確な融点は存在しないが,高温から の冷却とともに分子運動性の著しい遅化が 生じ,ある温度で分子運動に特徴的な時間ス ケールがマクロな時間スケールとクロスオ ーバーし,事実上分子運動の凍結が起こり 固化が生じる.この現象は**ガラス転移**と呼ば れ,その物理的な機構の解明は物性物理学に 残された難問の一つと考えられている、近年 のコンピュータシミュレーションや様々な 実験的な研究により、高温の液体状態から、 過冷却液体状態を経て,ガラス転移温度に近 づくに連れて,**動的不均一性**---分子運動の激 しさが空間内でヘテロに分布すること---が 顕著になり、分子運動性のスローダウンがガ ラス転移に密接に関わっていることが明ら かになっている.

2.研究の目的

これまでの高分子薄膜でのダイナミクス別定手法に高分子多層膜法を応用することを見り、高分子薄膜内でのガラス転移ダイ大転り、高分子薄膜内でのガラス転移がラスを関連を可能とし、ガラ神関でのガラスを表し、ガラ神関でのガラスを表し、ながでかる。本切のでは、あるのでは、なができる。とにより、変によりのでででは、なができる。とによりできる。

3. 研究の方法

研究期間は3年間(後に延長し,4年間とし た)とし,上記の研究目的を達成するために, 以下の3点に関して研究を行う. 様々は単 層膜厚および積層数のポリメチルメタクリ レート(PMMA)の積層薄膜を作製する.これら の積層薄膜に対して,示差走査熱量(DSC)測 定およびガラス転移温度以上での等温アニ ール過程での誘電緩和測定を行い,積層薄膜 のガラス転移温度の膜厚依存性,および, 過程のダイナミクスのアニール時間依存性 を明らかにする. ポリアミドランダム共重 合体を用いて,種々の膜厚の高分子薄膜を作 製し,誘電緩和測定を行う.これにより, 過程のダイナミクスと電荷担体の拡散運動 の同時測定を可能とし,両ダイナミクスの膜 厚依存性を明らかにする. 重水素化物と水 素化物でラベルした高分子を用いた**高分子 多層膜作成法**を確立し,とくに,積層界面で の構造と 過程のダイナミクスとの関係を 明らかにする.

4. 研究成果

(1) PMMA 積層薄膜のガラス転移とダイナミク

単層膜厚が 15nm, 48nm, 80nm の PMMA ス: 薄膜をそれぞれ 300 層, 100 層, 60 層積層し た PMMA 積層薄膜を作製する.スピンコート 法により,ガラス基板上に作製した単層の超 薄膜を水面上にリリースし, それを基板上, あるいは,基板に積層した PMMA 積層膜上に さらに積層する操作を繰り返すことにより、 必要な積層数の PMMA 積層薄膜を作製した. 通常の DSC 測定では数 mg の試料が必要であ るため, 超薄膜の場合, 大変多くの積層数が 必要となる .図 1 はこの積層膜を as-stacked な状態から昇温した場合の全熱流束の温度 変化を表している . 380K から 390K の間の温 度域で熱流束に異常が見られる.これまでの 測定データより,この熱異常がガラス転移に 伴うものであることがわかる.これより,ガ ラス転移温度を評価すると,明らかに,単層 膜厚が小さい PMMA 積層薄膜ではバルクな膜 と比較して、ガラス転移温度が低下している こと, さらには, その低下の度合が単層膜厚 の低下とともに大きくなることがわかる.こ の PMMA 積層薄膜のガラス転移温度の単層膜 厚依存性の存在は,積層薄膜の全膜厚が十分 マクロな値であっても,単層膜厚が小さい場 合は,全体として,薄膜の 過程のダイナミ クスを示すことを意味する. さらに, as-stacked な積層薄膜をガラス転移温度以 上で保持すると,単層膜厚に関わらず,バル クなガラス転移温度が得られる.この実験結 果は, as-stacked な状態では, 積層薄膜間 に明確な界面が存在し,この界面効果により 薄膜のダイナミクスが出現している.高温で のアニールにより,界面が消失し,バルクな ダイナミクスが回復したと推測される.もし この推論が正しいならば,積層薄膜の高温で のアニーリングにより、マクロなガラス転移 温度の制御が可能であると言える.

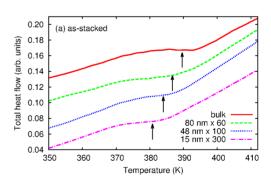


図 1: temperature dependence of total heat flow observed during the ramping process at 10K/min for as—stacked PMMA thin films.

次に,同様の PMMA 積層薄膜に対して,ガラス転移温度以上での等温アニール過程で誘電緩和測定を行い, 過程と 過程のダイナミクスのアニール時間・温度依存性を測定した.409K での等温アニール過程において,アニール時間,1時間毎に 1K/min の室温と409K 間の降温・昇温過程を挟み,その過程において誘電緩和測定を行う.等温アニール過程での温度よりも,低温側への温度変化であ

るので、ramping 過程での温度変化が等温アニール過程での誘電緩和測定に与える影響は無視できることが確認された。このramping 過程での誘電緩和測定により、過程の緩和率の温度依存性が図2に示すように得られた。as-stackedな状態では過程の緩和率は単層膜厚の減少とともに増加し、過程のダイナミクスが単層超薄膜で観測されるような速いダイナミクスとなっているの

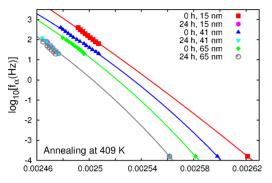


図 2: dependence of the relaxation rate of the alpha-process on the inverse of absolute temperature for 3 different PMMA stacked thin films.

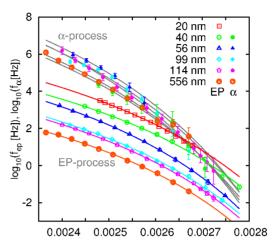
がわかる.しかし,ガラス転移温度以上での アニールにより,ゆっくりとした緩和へと変 化し,バルクのダイナミクスが得られること がわかる.また,緩和率の温度依存性は,単 層膜厚が小さい場合は,アレニウス的である のに対して,単層膜厚の増加とともに,バル クで観測される Vogel-Fulcher-Tammann 型へ と変化することがわかる.このことは,単層 膜厚が小さい場合は,この積層薄膜はstrong なガラスとして振舞い,高温でのアニールに より, fragile なガラスへと変化するといえ る.したがって,この積層薄膜を用いること により、適度なアニーリングにより、 過程 の分類に使用される fragility index の制御 が可能であることがわかる.

(2) ポリアミド共重合体薄膜のガラス転移とダイナミクス

ポリアミド共重合体から作製した種々の膜厚の薄膜に対して,誘電緩和測定を広い温度・周波数範囲で行うと,誘電損失スペクトに電極分極に起因したピーク(EP過程)と高分子鎖のセグメント運動に起因したピーク(過程)が観測される.これらの二つの過程の緩和時間の温度依存性を種々の分散地図が得られる.これより, EP過程とともとの緩和時間はいずれも膜厚の低下とともに短くなり,より速い緩和へと移行すること,

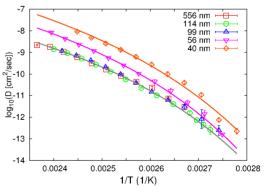
高温からガラス転移温度へ近づくと, 過程のプランチは EP 過程へとマージするように振る舞うことが明らかとなった .EP 過程 が電荷担体の拡散に起因するとした理論モ デルによると,EP 過程の緩和時間は膜厚(極 板間隔)に比例することが示されるが,本測 定データの定量的な解析からこの予言が確認された .EP 過程の緩和強度についても同様の膜厚に対する線形性が予言されるが , その点に関しても実験的に検証された .

様々な膜厚の試料に対する測定で得られた EP 過程の緩和時間と緩和強度の値を



☒ 3: dependence of the relaxation rate of the EP-process and the alpha-process on the inverse of absolute temperature observed for thin films of polyamide random copolymers with various film thicknesses.

Coelho らのモデルを用いて解析することにより、電荷担体の拡散係数と密度を温度・膜厚の関数として実験的に評価することができる.そのような解析結果が図4に示されている.図4は電荷担体の拡散係数の温度依存性はVFT型をこれより、拡散係数の温度依存性はVFT型を示すことかわかる.このことは電荷担体の拡散運動が、高分子鎖のセングメント運動である.さらに、膜厚が100nmまでは、拡散係数の温度依存性曲線は単一の曲線で記述され、膜厚依存性は見られない.100nmよりも膜厚が低下すると、温度一定の条件下で、より大



☑ 4: dependence of the diffusion constant of charge carriers observed through the EP-process on the inverse of absolute temperature observed for thin films of polyamide random copolymers with various film thicknesses.

きな拡散係数へと移行することが観測される.このことは,膜厚の低下に伴って電荷担体の拡散運動がより速い運動へと変化することを示している.

(3)積層薄膜での界面相互作用と 過程ダイナミクス

高分子積層薄膜のガラス転移ダイナミク スがガラス転移温度以上でのアニールによ り,薄膜でのダイナミクスからバルクでのダ イナミクスへ変化することが誘電緩和測定 により, 明らかになっている. このダイナミ クスの変化と積層界面の構造変化との関係 を実験的に明らかにする目的,中性反射率測 定を J-Parc の BL-16 (Sofia) において行っ た.対象とした系は,水素化 PMMA(h-PMMA) と重水素化 PMMA(d-PMMA)の交互積層膜であ る .409K での等温アニール過程において中性 子反射率の散乱ベクトル依存性のアニール 時間による変化を追跡した.得られた結果を フィッテングすることにより,d-PMMA 層と h-PMMA 層のそれぞれの膜厚と ,空気と h-PMMA 層の界面(表面)でのラフネスと h-PMMA 層 と d-PMMA 層の界面でのラフネスがアニール 時間の関数として得られた.これらの測定デ ータから以下の結果が得られた. ル時間の経過とともに, d-PMMA 層と h-PMMA 層の界面でのラフネスは増大し,相互拡散に よる層界面でのコントラストの低下が生じ ている. 同時に,アニール時間とともに, d-PMMA 層の膜厚は増加し,h-PMMA 層の膜厚 は減少することが観測された.この d-PMMA 層と h-PMMA 層の膜厚のアニール時間依存性 が異なる原因は界面での d-PMMA 層と h-PMMA 層の動的な非対称性が原因であることが考 えられる.この動的非対称性と界面構造の関 係の詳細は本プロジェクトの後継プロジェ クトにおいて更なる解明が試みられている.

5. 主な発表論文等

(研究代表者,研究分担者及び連携研究者に は下線)

[雑誌論文](計8件)

T. Hayashi, K. Segawa, <u>K. Sadakane</u>, <u>K. Fukao</u>, N. L. Yamada, Interfacial interaction and glassy dynamics in stacked thin films of poly(methyl methacrylate), J. Chem. Phys., 146, 203305-1-8 (2017) (查読有).

DOI:10.1063/1.4974835.

Y.Nozaki, K. Yamaguchi, K. Tomida, N. Taniguchi, H.Hara, Y.Takikawa, <u>K. Sadakane</u>, K. Nakamura, T. Konishi, <u>K. Fukao</u>, Phase Transition and Dynamics in Imidazolium-Based Ionic Liquid Crystals through a Metastable Highly Ordered Smectic Phase, J. Phys. Chem. B,120, 5291-5300, (2016) (查読有). DOI: 10.1021/acs.jpcb.6b03804. T.Konishi, W.Sakatsuji, <u>K.Fukao</u>, Y. Miyamoto, Temperature Dependence of

Lamellar Thickness in Isothermally Crystallized Poly (butylene terephthalate), Macromolecules, 49, 2272-2280, (2016) (査読有).

DOI: 10.1021/acs.macromol.6b00126.

N.Taniguchi, <u>K. Fukao</u>, P. Sotta, D. R. Long, Dielectric relaxation of thin films of polyamide random copolymers, Physical Review E, 91, 052605-1-13, (2015)(查読有). DOI:10.1103/PhysRevE.91.052605.

T.Kawamoto, Dan-Thuy Van-Pham, H. Nakanishi, T.Norisuye, Qui Tran-Cong-Miyata, <u>K.Fukao</u>, Effects of molecular weight on the local deformation of photo-cross-linked polymer blends studied by Mach–Zehnder interferometry, Polymer J.,46,819-822 (2014)(查読有).

DOI:10.1038/pj.2014.63.

T.Hayashi, <u>K. Fukao</u>, Segmental and local dynamics of stacked thin films of poly(methyl methacrylate), Phys. Rev.E, 89, 022602 (2014) (查読有).

DOI:10.1103/PhysRevE.89.022602.

[学会発表](計64件)

Y. Nozaki, K. Yamaguchi, K. Tomida, N. Taniguchi, H. Hara, Y. Takikawa, <u>K. Sadakane</u>, K.Nakamura, T.Konishi, <u>K.Fukao</u>, Phase Transition and Dynamics in Ionic Liquid Crystals, EMN Meeting on Ionic Liquids Energy Materials Nanotechnology, Nov 11, 2016 Bangkok, Thailand (招待講演). N.Taniguchi, <u>K. Fukao</u>, P. Sotta, D. Long, Electrode Polarization and Glassy Dynamics in Thin Films of Polyamide Random Copolymers, 9th International Conference on Broadband Dielectric Spectroscopy and its Application, 2016.9.14, Pisa, Italy (口頭発表).

N.Taniguchi, <u>K. Fukao</u>, P. Sotta, D. Long, Electrode Polarization Process and Glassy Dynamics in Thin Films of Polyamide Random Copolymers, The XVII-th International Congress on Rheology (ICR2016), 2016.8.12, Kyoto Terrsa, Kyoto, Japan (口頭 発表).

M.Hachiya, K.Sadakane, K.Fukao,

Surface-inactive effect induced by adding nonionic surfactants on a mixture of water and organic solvent, EMN Meeting on droplets 2016, 2016.5.12, San Sebastian, Spain (招待講演).

K. Fukao, N. Taniguchi, T. Hayashi, P. Sotta, D. Long, Molecular dynamics of single and stacked thin polymer films, the 8th International Conference on Broadband Dielectric Spectroscopy and its Applications, September 15, 2014, Wisla, Poland (口頭発表).

K. Fukao, H. Takaki, T. Hayashi,

Glass transition and dynamics of multi-layered thin polymer films, 7th International Discussion Meeting on Relaxations in Complex Systems, Jul. 24, 2013, Barcelona, Spain (招待講演).

[図書](計4件)

<u>K. Fukao</u>, Glassy and aging dynamics in polymer films investigated by dielectric relaxation spectroscopy, Polymer Glasses, 243-266 (2016). ISBN:978-14987-1187-6, DOI:10.1201/9781315305158-10.

深尾 浩次 ,高分子材料の交流インピーダンス法による誘電評価 ,正しい電気特性の測定 ,評価とデータ解釈 ,(株)技術情報協会 ,第 6 章 ,第 1 節,255-259 (2015).

K. Fukao, H. Takaki, T. Hayashi,

Heterogeneous dynamics of multi-layered thin polymer films, in "Dynamics in Geometrical Confinement", Advances in Dielectrics, 179-212 (2014).

DOI:10.1007/978-3-319-06100-9 8.

深尾 浩次 ,高分子の誘電インピーダンス 測定の原理,測定例と注意点 ,電気化学/ インピーダンス測定のノウハウと正しい データ解釈,(株)技術情報協会,5 章5 節,508-511 (2013).

[その他]

研究代表者のホームページ

http://www.softmat.se.ritsumei.ac.jp

6. 研究組織

(1)研究代表者

深尾 浩次 (FUKAO KOJI)

立命館大学・理工学部・教授

研究者番号:50189908

(2)研究分担者

貞包 浩一朗(SADAKANE KOICHIRO)

立命館大学・理工学部・助教

研究者番号:50585148

(3)研究協力者

ディディエール・ロング (DIDIER LONG) CNRS/Solvay・LPMA・ディレクター

ポール・ソタ(Paul Sotta)

CNRS/Solvay·LPMA·主任研究員